

# リソグラフィ技術最前線 = 液浸露光技術 =

有機エレ材研(JOEM)

【 オルガテクノ 2006 有機テクノロジー展 共催 】

《日 時》 2006 年 7 月 25 日(火) 13時30分～16時10分

《会 場》 パシフィコ横浜 Web Site: <http://www.pacifico.co.jp/>

《プログラム》

座長 日立化成 上野 巧

13:30～14:20 「ArF 液浸リソグラフィ =背景および技術の進行状況と課題=」

半導体先端テクノロジーズ 田中 稔彦

14:20～15:10 「液浸用 ArF 露光装置の現状と将来」 キヤノン 小林 正道

15:10～16:00 「EUV リソグラフィの最新状況と

高エネルギーリソグラフィに対する一考察」 ニコン 鈴木 一明

16:00～16:10 補充討論・総括討論

参加費:参加費、講演要旨集代は無料です。

会員以外は参加費として 5,000 円を当日受付にて申し受けます。

懇親会費:今回は懇親会はありません。

参加登録:参加登録, 登録の変更は, 7 月 14 日(金) までに, 次へお願いします。

(締切日後の参加申込は非会員扱いとなりますので

(1) Web site: <http://www.organic-electronics.or.jp/> 経由『参加登録』画面

(Yahoo などでも検索できます)

(2) F A X: 0268-21-5413 (参加証は発行しません)

※ 締め切り期日を過ぎてからの参加申し込みは要旨集を配布できない場合がございますのでご注意ください。

中間法人 有機エレクトロニクス材料研究会(The Japanese Research Association for Organic Electronics Materials)



= ご注意 =

今回は会員・非会員に関わらず、参加登録されている場合は総合受付でフリーパスとなり展示会もご覧いただけます。

【JR横浜駅から】

みなとみらい駅ー徒歩 3 分

桜木町駅ー徒歩 12 分

【お車】

首都高速ー横羽みなとみらいランプー3 分

東名高速横浜町田 I Cー33 分